

株式会社 トリケミカル研究所

第43期(2021年1月期)

第2四半期決算説明資料

東京証券取引所
証券コード:4369

2020.9.3

1. 2021年1月期第2四半期決算実績

2021年1月期第2四半期連結業績の概要(総括)

単位:百万円

	21.1期 上期実績	21.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 20.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	4,812	4,460	107.9%	4,152	660	15.9%
営業利益	1,547	1,210	127.9%	1,153	394	34.1%
経常利益	2,296	1,750	131.2%	1,777	519	29.2%
当期純利益	1,796	1,340	134.0%	1,378	418	30.3%

！ 計画を大きく上回り、半期としては売上・利益とも過去最高を更新
 ！ 韓国関係会社SK Tri Chem等による持分法利益755百万円計上

連結貸借対照表

単位:百万円

	(ご参考) 20.1期末	20/7月末	増減額
流動資産	6,147	7,137	990
固定資産	8,997	10,312	1,315
資産合計	15,144	17,450	2,306
流動負債	3,050	3,920	869
固定負債	2,512	2,743	231
負債合計	5,562	6,663	1,101
株主資本	9,656	10,999	1,343
その他包括利益累計額	-74	-212	-138
純資産合計	9,581	10,787	1,205
負債純資産合計	15,144	17,450	2,306

主な増減要因

流動資産

売上債権の増加	468
棚卸資産の増加	287

固定資産

設備投資に伴う有形固定資産の増加	1,006
持分法利益取込に伴う投資有価証券の増加	285

流動負債

短期借入金の増加	500
未払金の増加	190

固定負債

長期借入金の増加	237
----------	-----

純資産

当期純利益計上等による利益剰余金の増加	1,343
---------------------	-------

連結キャッシュ・フロー

単位:百万円

	(ご参考) 20.1期上期	21.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	883	1,354
投資活動による キャッシュ・フロー	-747	-1,286
財務活動による キャッシュ・フロー	-85	196
現金及び現金 同等物の増減額	49	264
現金及び現金同等 物の四半期末残高	1,644	1,882

各CFの状況等

営業CF

税前純利益計上	2,296
減価償却費計上	358
利息・配当金の受取額	308
持分法による投資利益	-755
売上債権の増加額	-468
法人税等の支払額	-440

投資CF

有形固定資産の取得 -1,258

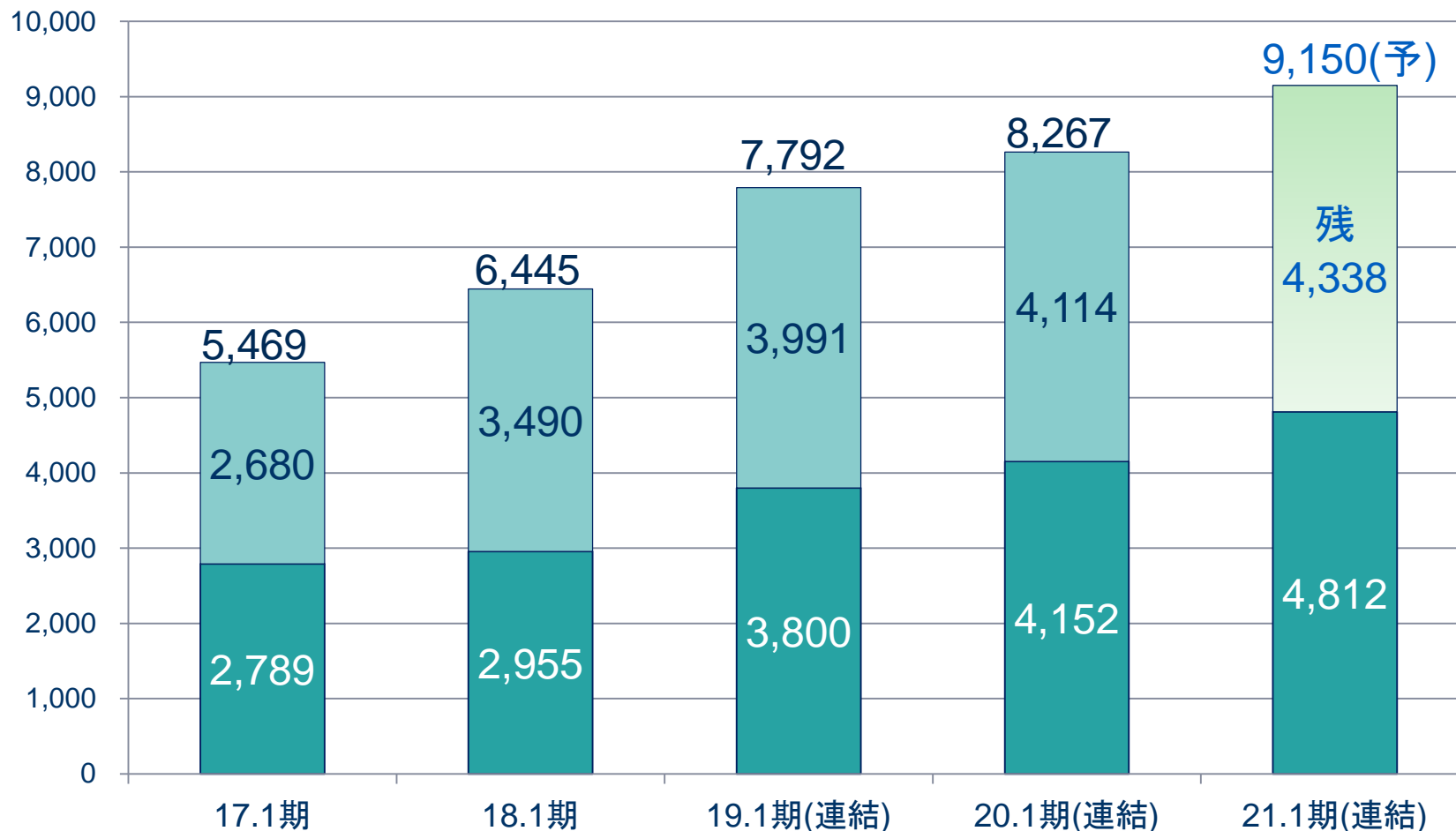
財務CF

借入金調達・返済 690
 配当金の支払 -453

販売実績

(下部は上期実績)

単位:百万円



※18.1期までは単体での数字となっているため、比較はあくまでご参考となります。

売上分析(ユーザー地域別)

単位: 百万円

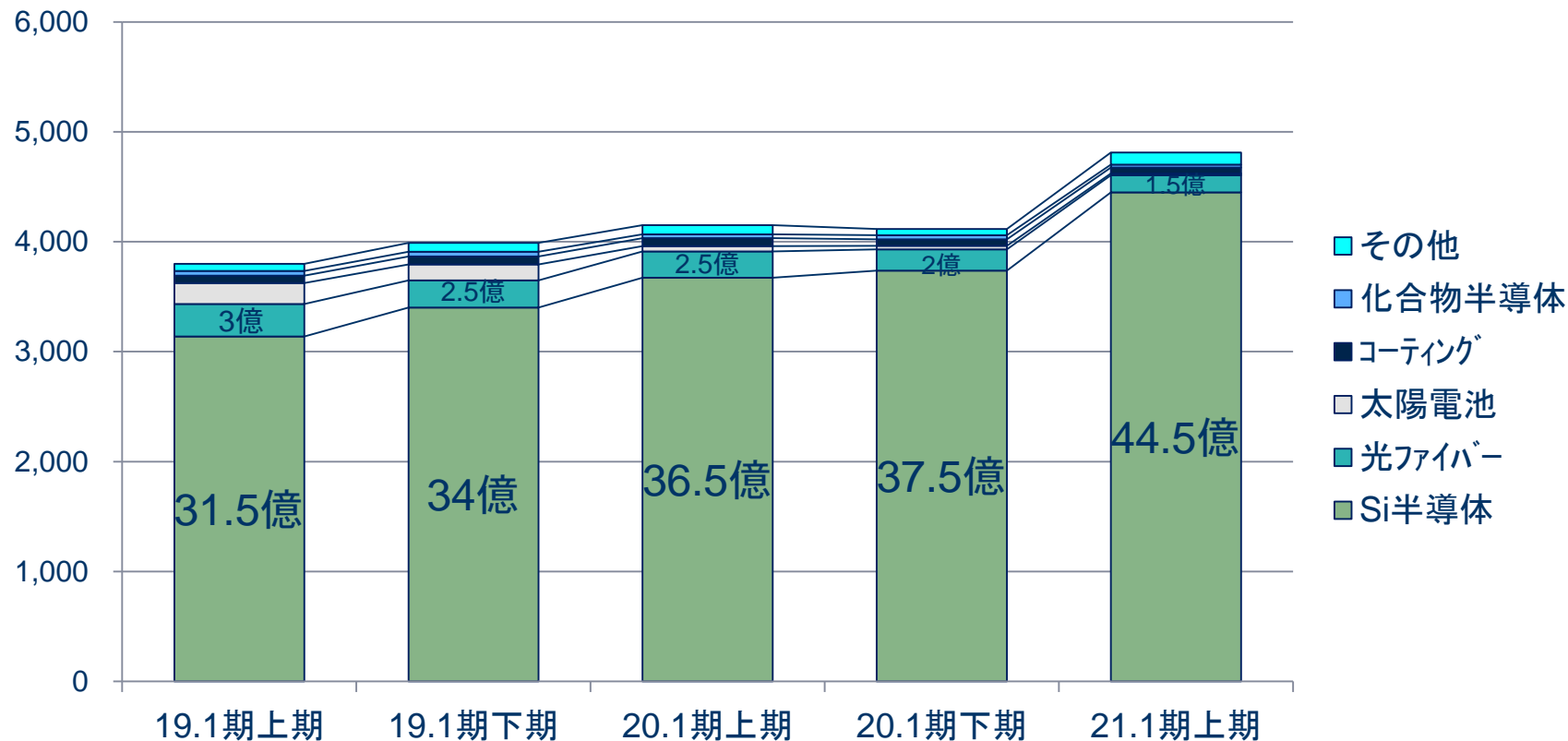


※当社推定による概算値

！韓国向け売上を中心に各国とも堅調に推移

売上分析(製品用途別)

単位: 百万円

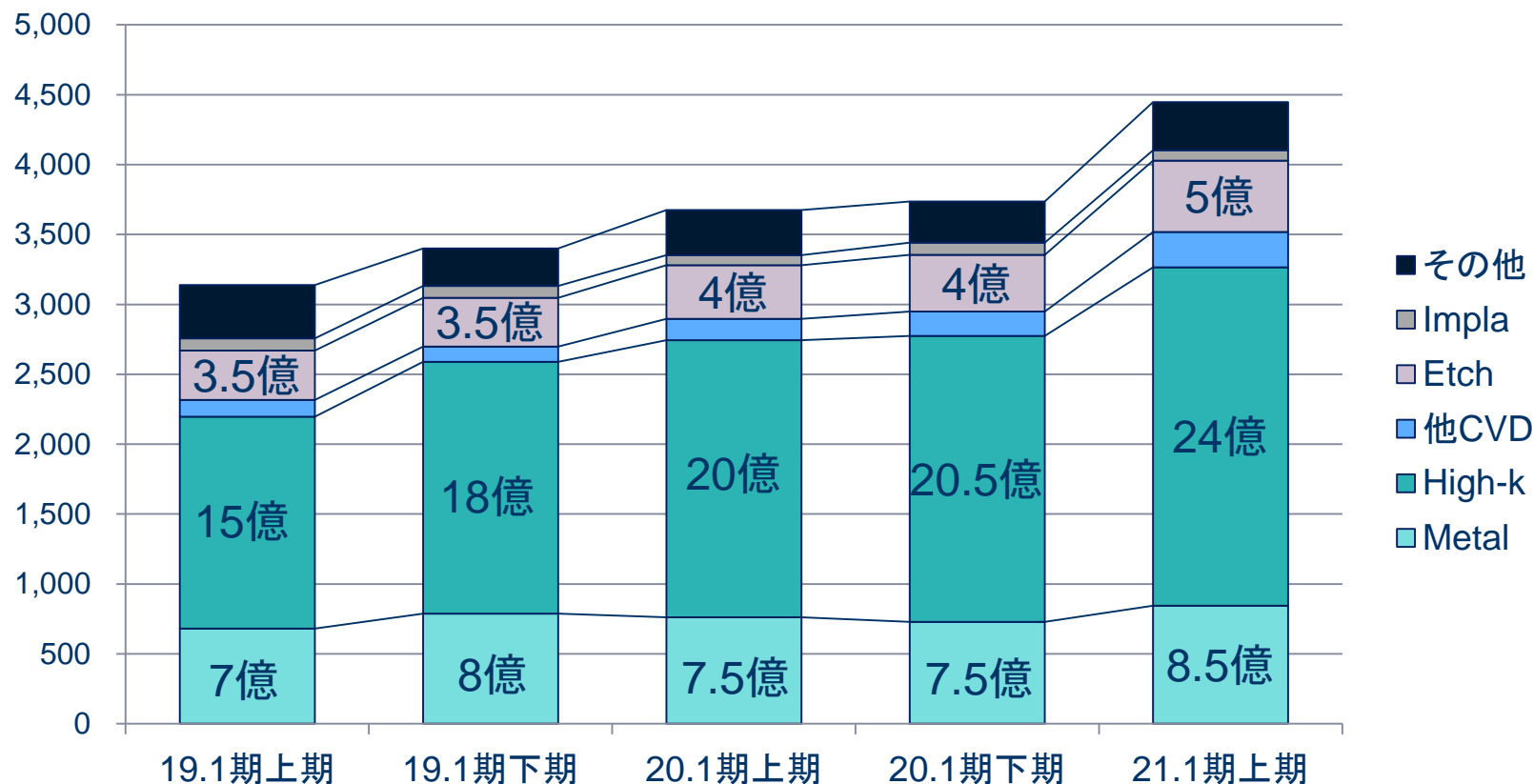


※当社推定による概算値

！主力の半導体向け売上はコロナ下でも好調に推移

売上分析(Si半導体)

単位: 百万円

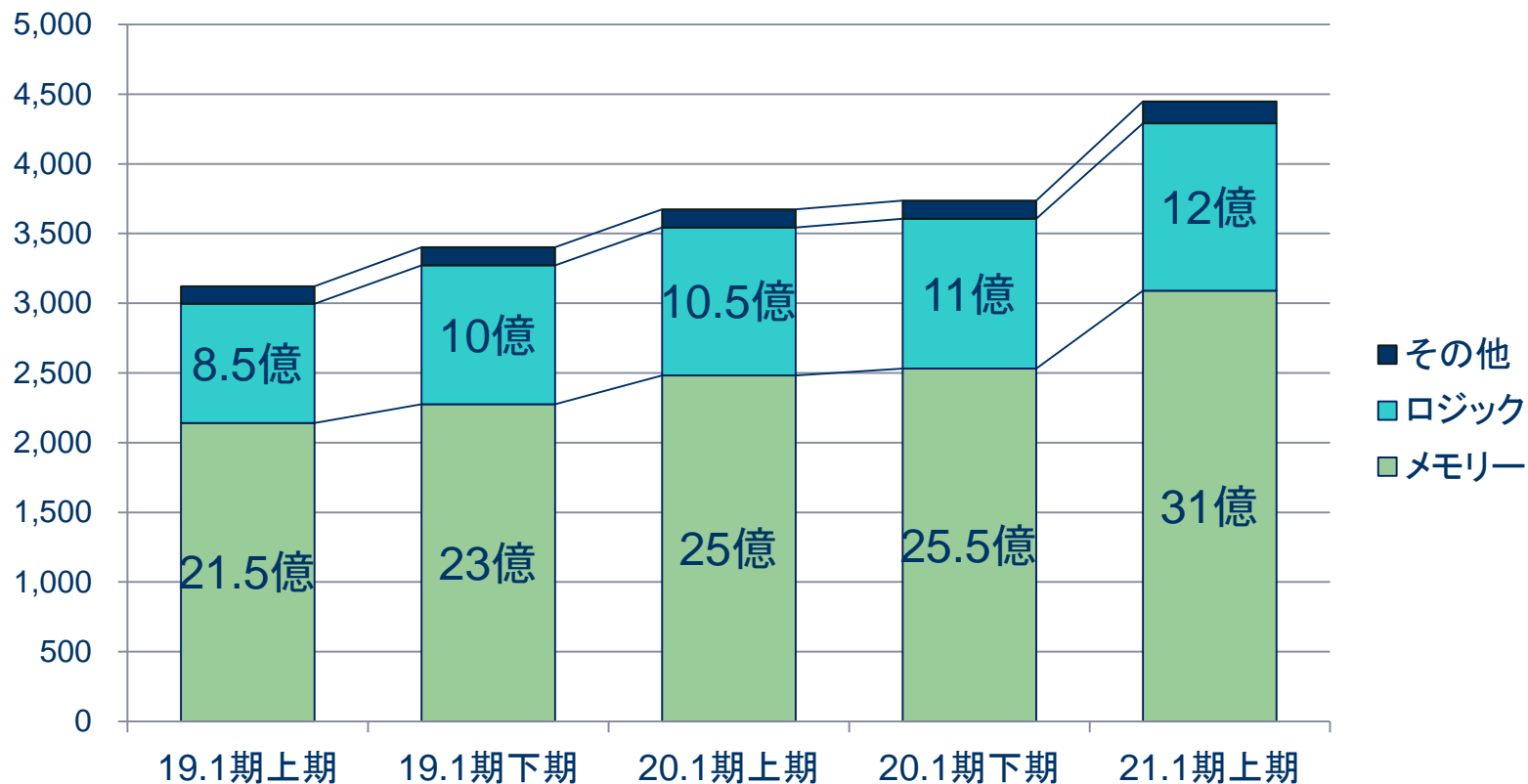


※当社推定による概算値

! High-k材料を中心に全体的に成長

売上分析(半導体向け先別)

単位: 百万円

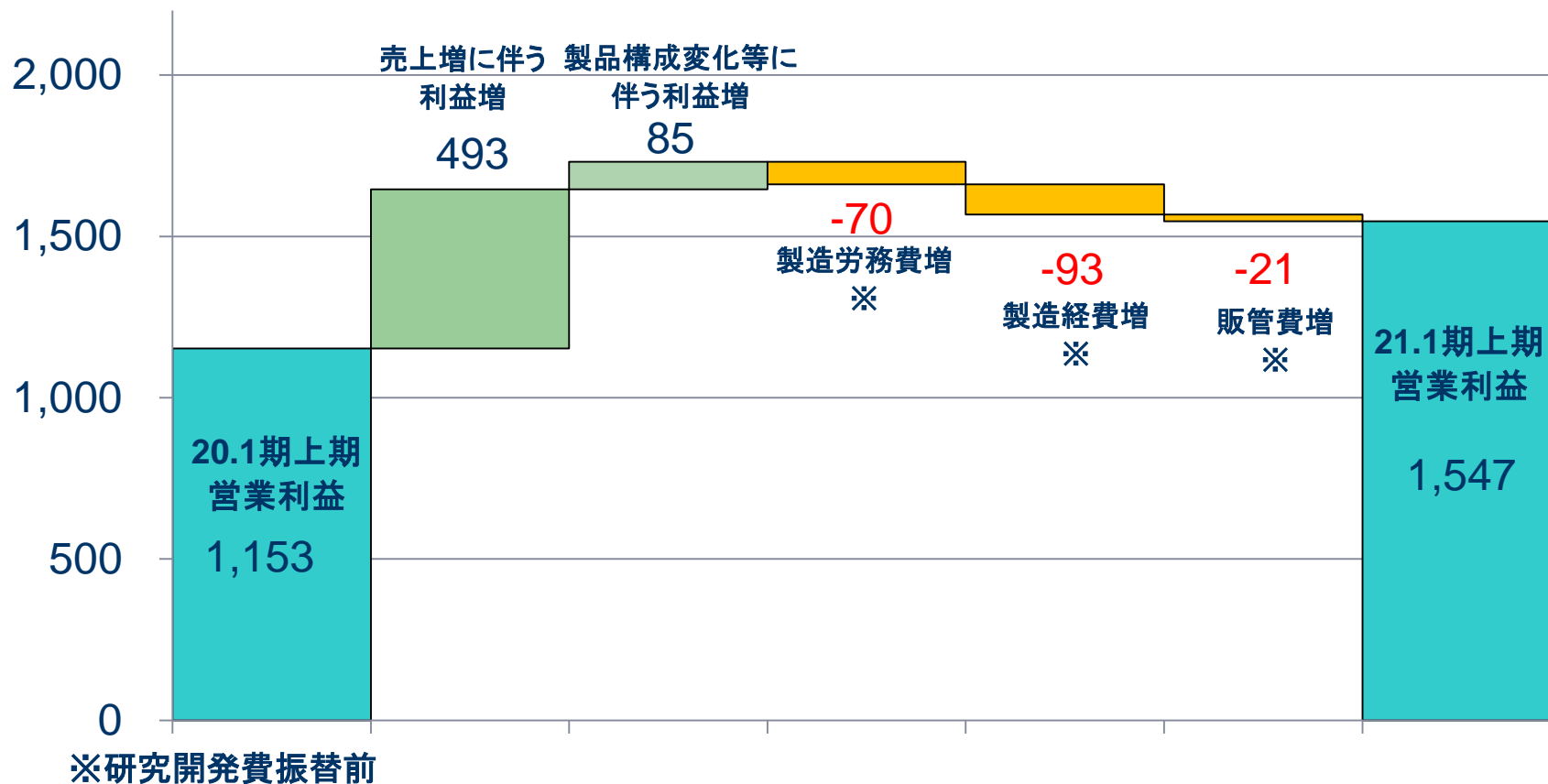


※当社推定による概算値

！メモリー向けは韓国・日本中心に成長を継続
！台湾ロジック向け材料の成長

2021年1月期営業利益増減要因

単位: 百万円



！売上大幅増と合理化を中心とした利益成長を達成

2. 2021年1月期通期見通し及び戦略

2021年1月期通期見通し

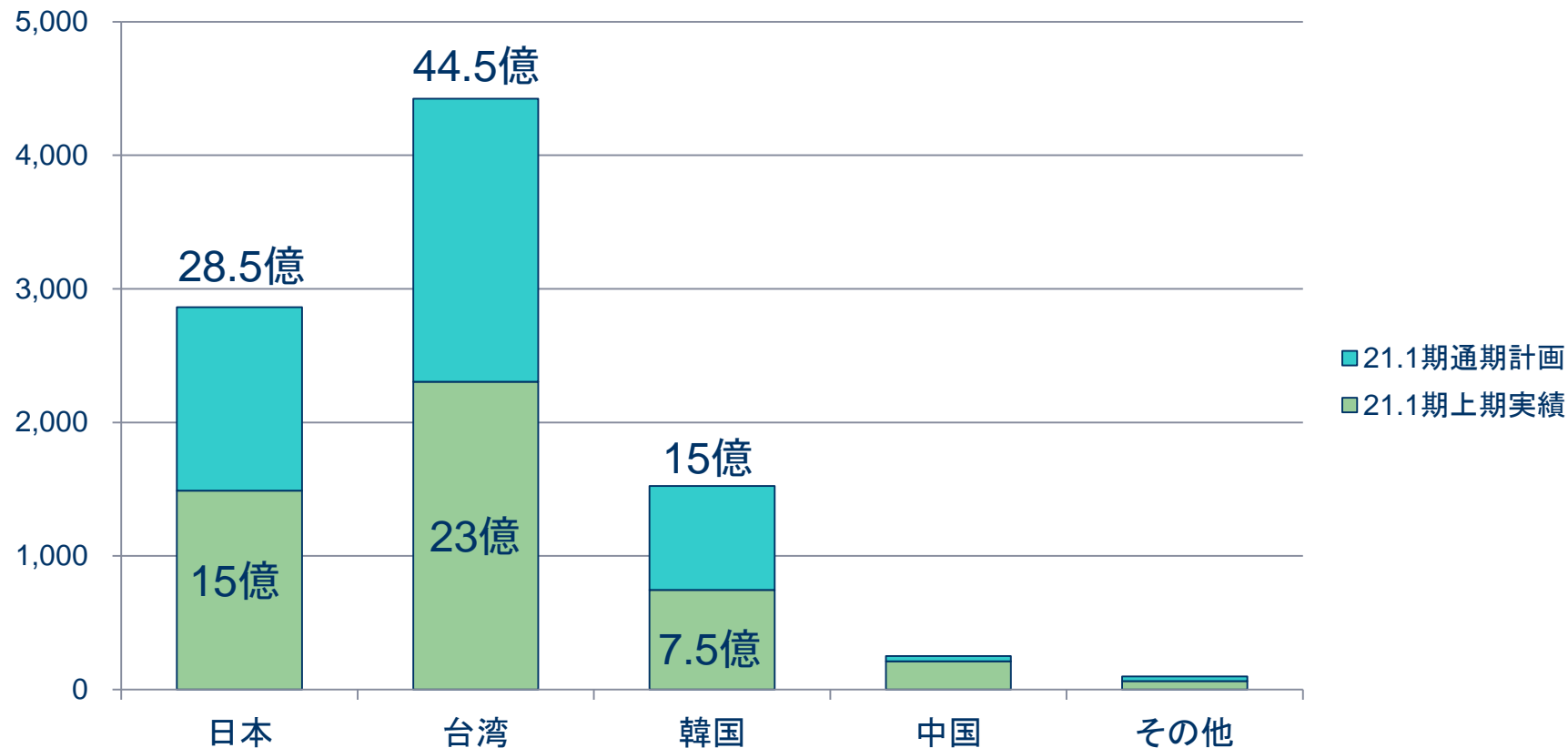
単位：百万円

	21.1期上期	21.1期通期 (計画)	進捗率	(ご参考) 20.1期通期
売上高	4,812	9,150	52.6%	8,267
営業利益	1,547	2,370	65.3%	2,326
経常利益	2,296	3,770	60.9%	3,744
当期純利益	1,796	2,940	61.1%	2,939

！ 売上・利益ともに順調な進捗

売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

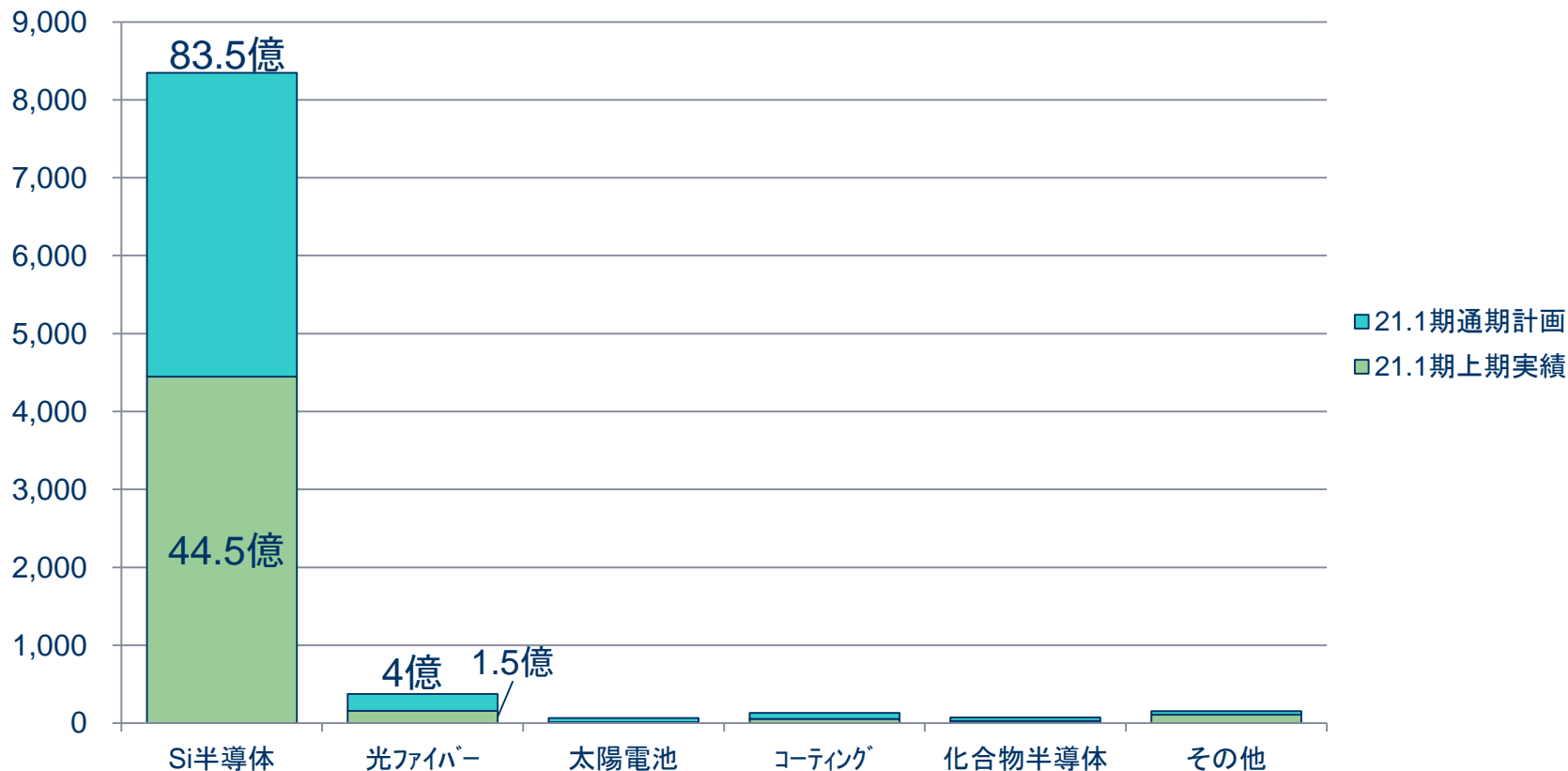


※当社推定による概算値

！台湾向け売上は好調に推移

売上進捗分析(製品用途別)

単位: 百万円

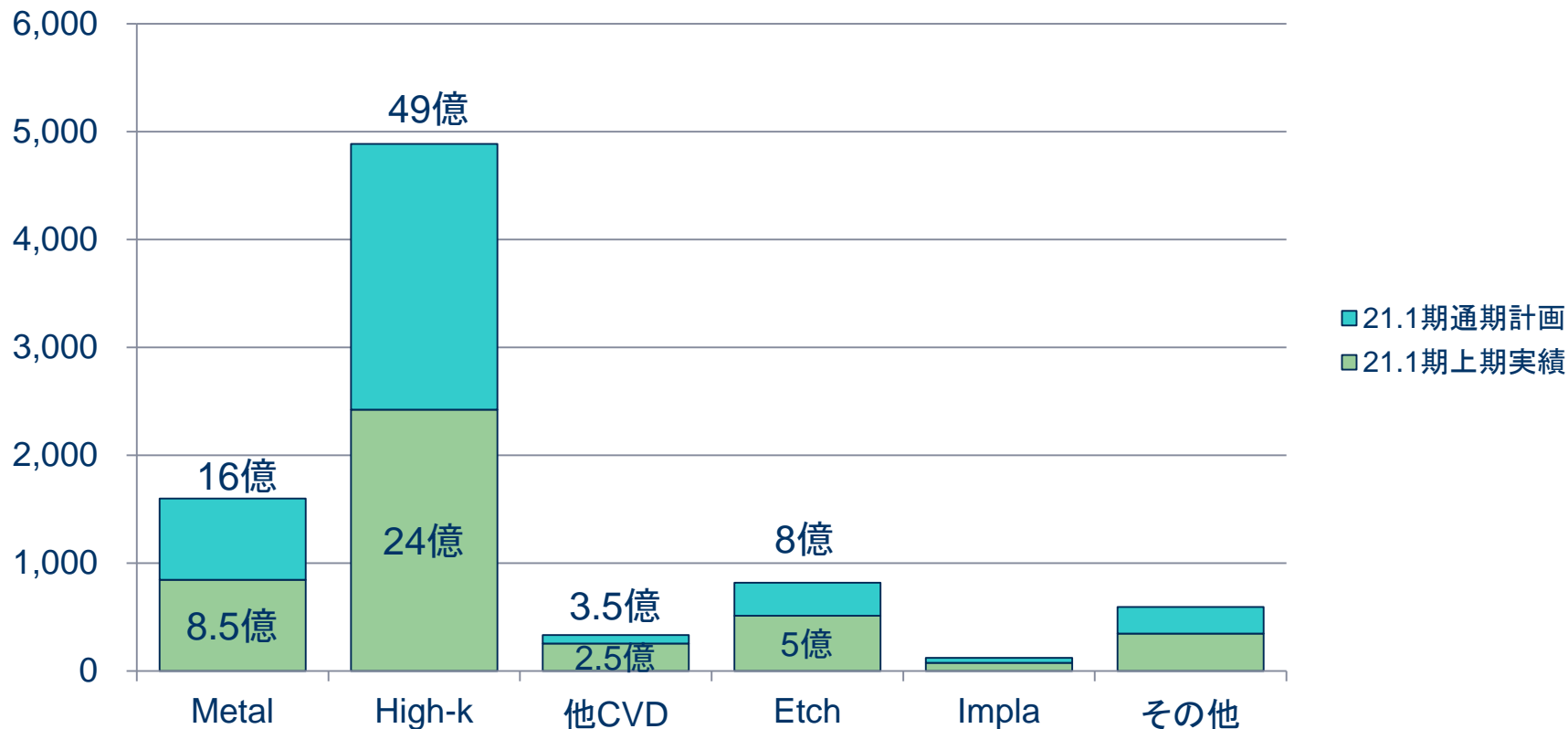


※当社推定による概算値

！主力の半導体向けは順調に進捗

売上進捗分析(Si半導体)

単位: 百万円

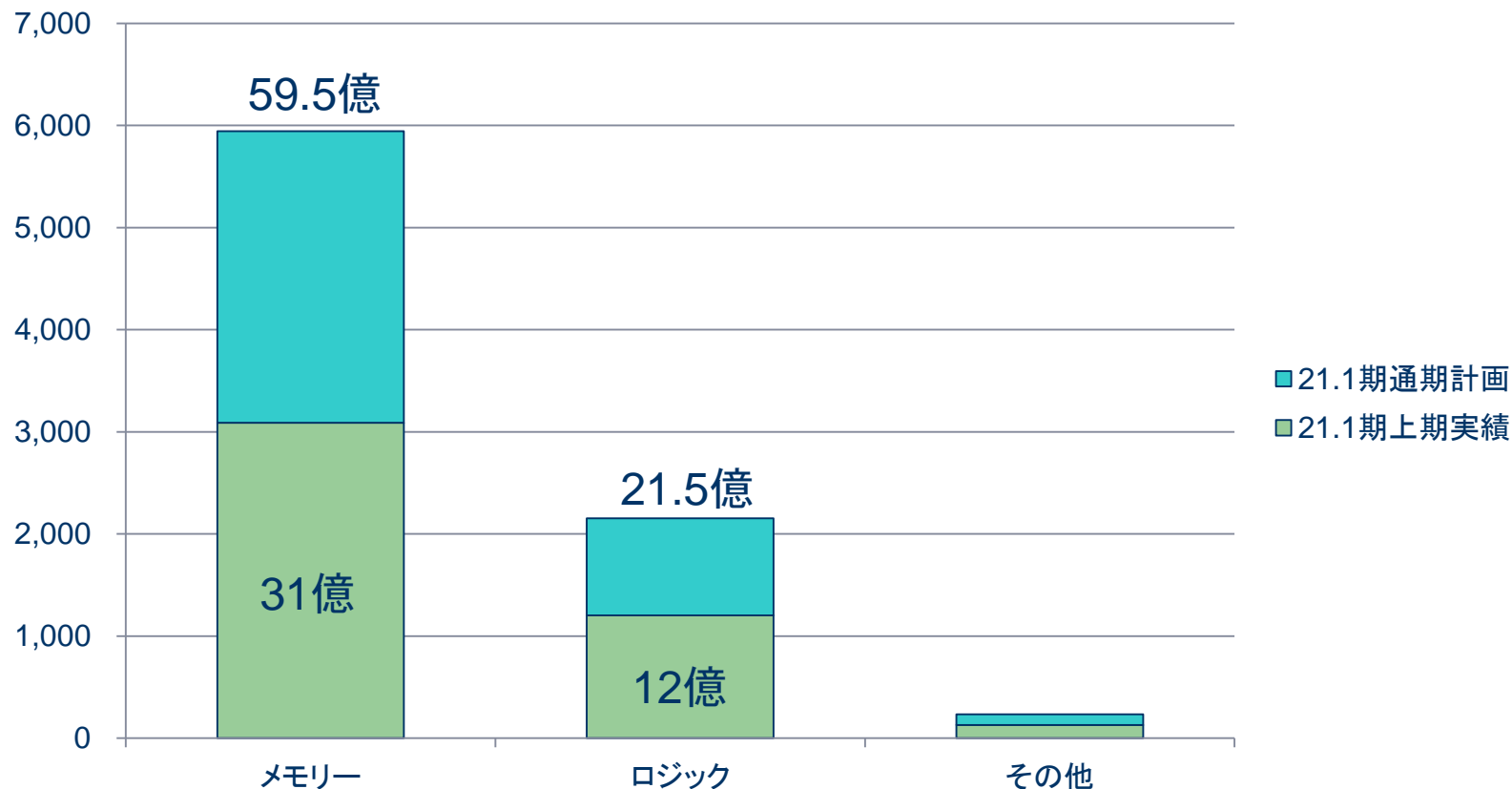


※当社推定による概算値

！ High-k向け材料は韓国を中心にさらなる成長を

売上進捗分析(半導体向け先別)

単位: 百万円



※当社推定による概算値

！メモリー・ロジック共に堅調に推移

2021年1月期下期の見通し

外部環境見通しなど

1. COVID-19の影響は現状限定的(半導体向けはほぼなし)。
2. 米中貿易摩擦の影響は今のところほぼなし
3. 想定レートは\$1=¥107(期初から変更なし)
感応度は1円で約28百万円
4. 半導体向け以外はCOVID-19の影響が継続

下期の施策

1. 台湾子会社工場・Annex棟の早期立ち上げ
2. 新規材料(Metal、High-k材料等)の生産性向上継続

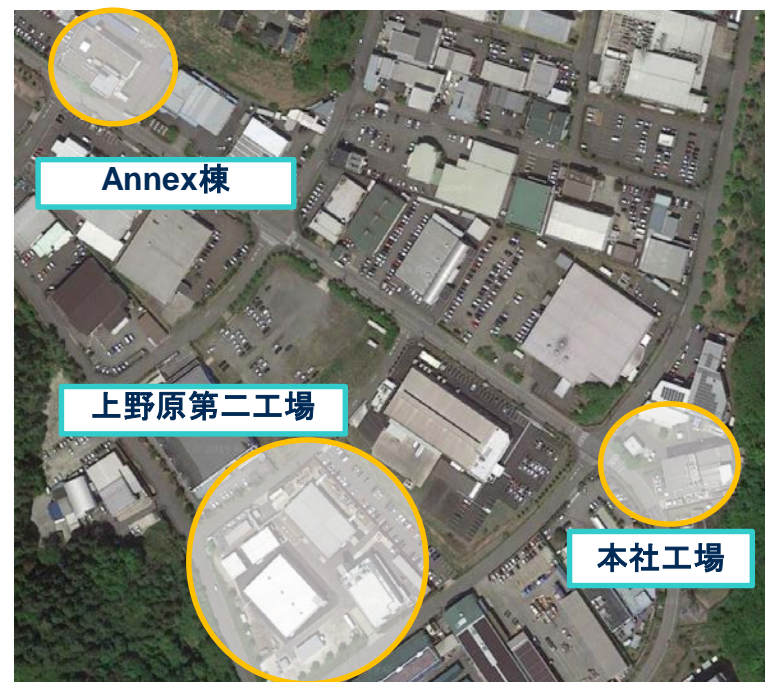
3. 中期経営計画各施策の進捗について

1.台湾子会社新工場建設



現在装置搬入・立ち上げ作業中

2. Annex棟増築



品質管理体系の強化を図るための分析設備の拡充
9月末の竣工を予定

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先 : homepageinfo2@trichemical.com

用語集(Page 9・16)

Impla

Ion Implantation=イオン注入。半導体に使用されるSi(シリコン)は本来電気を通しにくい物質ですが、ホウ素やリン等のイオンを注入することで、条件によって絶縁性能が変化する「半導体」となります。

Etch

Etching(エッチング)。ウエハ上に積んだ膜のうち、不要なものを化学反応により削る工程です。

CVD材料

CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長)法とは、化学材料の蒸気を熱などにより分解しウエハ上に堆積させる技術であり、**CVD材料**とはその際に用いられる化学材料を指します。堆積させる薄い膜は絶縁膜や金属・導体膜・半導体膜であり、使用される材料は多岐にわたっております。

また、半導体の微細化・高性能化を進めるために、従来の製法・材料では解決できない電気的な問題を解決するための誘電率の低い膜が得られる低誘電率層間絶縁膜(Low-k)材料や逆に誘電率の高い膜が得られる高誘電率絶縁膜(**High-k**)材料・物理的な問題を解決するための金属窒化膜(**Metal**)材料などといった新たなニーズに対応するための材料をいち早く提案し、安定供給するのが当社の特徴であります。